REC'D 1 4 JAN 2000

PCT/JP99/06428

J+99 /6478

本^{WIP}国 特^{CT} 許
PATENT OFFICE

17.11.99

ENV

JAPANESE GOVERNMENT 09/830949

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

1999年 4月 5日

出 願 番 号 Application Number:

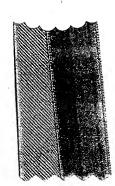
平成11年特許願第097648号

出 願 人 Applicant (s):

イビデン株式会社



PRIORITY
DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



1999年12月24日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office

近 藤 隆



【書類名】

特許願

【整理番号】

111140

【提出日】

平成11年 4月 5日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H05K 1/34

【発明者】

【住所又は居所】

岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1-1 イビデン株式会社大

垣北工場内

【氏名】

伊藤 均

【発明者】

【住所又は居所】

岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1-1 イビデン株式会社大

垣北工場内

【氏名】

岩田 義幸

【発明者】

【住所又は居所】

岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1-1 イビデン株式会社大

垣北工場内

【氏名】

広瀬 直宏

【特許出願人】

【識別番号】

000000158

【住所又は居所】 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

【氏名又は名称】 イビデン株式会社

【代表者】

遠藤優

【代理人】

【識別番号】

100095795

【住所又は居所】 名古屋市中区上前津2丁目1番27号 堀井ビル3階

【弁理士】

【氏名又は名称】 田下 明人

【選任した代理人】

【識別番号】

100098567

特平11-097648

【住所又は居所】 名古屋市中区上前津2丁目1番27号 堀井ビル3階

【弁理士】

【氏名又は名称】 加藤 壯祐

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

平成11年特許願第 34616号

【出願日】

平成11年 1月 4日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

054874

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9401314

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 導電性接続ピンおよびパッケージ基板 【特許請求の範囲】

【請求項1】 パッケージ基板に固定されて他の基板との電気的接続を得る ための導電性接続ピンにおいて、

前記導電性接続ピンが柱状の接続部と板状の固定部よりなり、前記柱状の接続部に他の部分の直径よりも小さいくびれ部が形成されていることを特徴とする導電性接続ピン。

【請求項2】 前記くびれ部の直径が、他の部分の直径の50%以上98% 以下であることを特徴とする導電性接続ピン。

【請求項3】導体層を設けた基板上に、他の基板との電気的接続を得るための導電性接続ピンが固定されてなるパッケージ基板において、

前記導電性接続ピンは、柱状の接続部と板状の固定部よりなり、前記柱状の接続部に他の部分の直径よりも小さいくびれ部が形成され、

前記導体層の一部または全部に前記導電性接続ピンを固定するためのパッドが 形成され、

前記パッドに前記導電性接続ピンの固定部が導電性接着剤を介して固定されていることを特長とするパッケージ基板。

【請求項4】 前記導体層は、前記パッドを部分的に露出させる開口部が形成された有機樹脂絶縁層で被覆され、前記開口部から露出したパッドに前記導電性ピンが導電性接着剤を介して固定されていることを特徴とする請求項3に記載のパッケージ基板。

【請求項5】 前記パッドの直径は、開口部の直径の1.02~100倍であることを特徴とする請求項4に記載のパッケージ基板

【請求項 6】 前記基板が導体層と層間樹脂絶縁層とが交互に積層された構造を少なくとも一つ以上有するビルトアップ基板であることを特徴とする請求項3ないし5のいずれか1に記載のパッケージ基板。

【請求項7】 導体層と層間樹脂絶縁層とが交互に積層された構造を少なく

とも一つ以上有するビルドアップ基板に、他の基板との電気的接続を得るための 導電性接続ピンが固定されてなるパッケージ基板において、

前記導電性接続ピンは、柱状の接続部と板状の固定部よりなり、前記柱状の接 続部に他の部分の直径よりも小さいくびれ部が形成され、

前記ビルドアップ基板の最外層の導体層の一部または全部に、前記導電性接続 ピンを固定するためのパッドが形成され、

前記パッドは、バイアホールを介して内層の導体層に接続されるとともに、前記パッドに導電性接続ピンが導電性接着剤を介して固定されていることを特徴とするパッケージ基板。

【請求項8】 導体層が形成されたコア基板の両面に導体層と層間樹脂絶縁層とが交互に積層された構造を少なくとも一つ以上有するビルドアップ基板に、他の基板との電気的接続を得るための導電性接続ピンが固定されたパッケージ基板において、

前記導電性接続ピンは、柱状の接続部と板状の固定部よりなり、前記柱状の接 続部に他の部分の直径よりも小さいくびれ部が形成され、

前記ビルドアップ基板の、最外層の導体層の一部または全部に、前記導電性接続ピンを固定するためのパッドが形成され、

前記パッドはバイアホールを介して前記コア基板の導体層に接続されるととも に、当該パッドには導電性接続ピンが導電性接着剤を介して固定されていること を特徴とするパッケージ基板。

【請求項9】 導体層を備えたスルーホールが形成されてなるコア基板の両面に、導体層と層間樹脂絶縁層とが交互に積層された構造を少なくとも一つ以上有するビルドアップ基板に、他の基板との電気的接続を得るための導電性接続ピンが固定されたパッケージ基板において、

前記導電性接続ピンは、柱状の接続部と板状の固定部よりなり、前記柱状の接 続部に他の部分の直径よりも小さいくびれ部が形成され、

前記ビルドアップ基板の、最外層の導体層の一部または全部に、前記導電性接続ピンを固定するためのパッドが形成され、

前記パッドは、前記スルーホールの導体層とバイアホールを介して接続されて

いるとともに、当該パッドには導電性接続ピンが導電性接着剤を介して固定されていることを特徴とするパッケージ基板。

【請求項10】 前記パッドは、少なくとも一つ以上のバイアホールを介して内層の導体層に接続していることを特徴とする請求項7ないし9のいずれか1に記載のパッケージ基板。

【請求項11】 前記パッドは、リング状のバイアホールを介して内層の導体層に接続されていることを特徴とする請求項7ないし10のいずれか1に記載のパッケージ基板。

【請求項12】 前記パッドは、少なくとも二層以上に設けられたバイアホールを介して内層の導体層と接続していることを特徴とする請求項7ないし11のいずれか1に記載のパッケージ基板。

【請求項13】 前記最外層の導体層は、パッドを部分的に露出させる開口部が形成された有機樹脂絶縁層で被覆され、前記開口部から露出したパッドに前記導電性接続ピンが導電性接着剤を介して固定されていることを特徴とする請求項7ないし12のいずれか1に記載のパッケージ基板。

【請求項14】 前記パッドの直径は、前記開口部の直径の1.02~10 0倍であることを特徴とする請求項12に記載のパッケージ基板。

【請求項15】 前記導電性接続ピンは、リン青銅製であることを特徴とする請求項7ないし14のいずれか1に記載のパッケージ基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、導電性接続ピンおよび導電性接続ピンが固定された樹脂パッケージ基板に関する。

[0002]

【従来の技術】

ICチップ等をマザーボード又はドータボードへ接続するためのパッケージ基板は、近年、信号の高周波数化に伴い、低誘電率、低誘電正接が求められるようになった。そのため、基板の材質もセラミックから樹脂へと主流が移りつつある



このような背景の下、樹脂基板を用いたプリント配線板に関する技術として、例えば、特公平4-55555号公報に、回路形成がなされたガラスエポキシ基板にエポキシアクリレートを層間樹脂絶縁層として形成し、続いて、フォトリソグラフィの手法を用いてバイアホール用開口を設け、表面を粗化した後、めっきレジストを設けて、めっきにより導体回路およびバイアホールを形成した、いわゆるビルドアップ多層配線板が提案されている。

[0004]

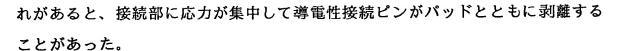
このようなビルドアップ多層配線板をパッケージ基板として使用する場合には、マザーボードやドータボードへ接続するための導電性接続ピンを取り付ける必要がある。

このピンはT型ピンと呼ばれ、図17に示すように柱状の接続部122と板状の固定部121とで側面視略T字形状に形成されており、接続部122を介してマザーボードのソケット等に接続するようになっている。この導電性接続ピン120は、ビルトアップ多層配線板の最外層の層間樹脂絶縁層200(又は、コア基板)の導体層をパッド16とし、このパッド16にハンダなどの導電性接着剤17を介して接着固定される。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述した構造では、パッド16とその内層の層間樹脂絶縁層2 00との接着面積が小さいことに加え、金属製のパッドと樹脂絶縁層という全く 異なる材質ため、両者の接着強度が充分でないという問題があった。そのため、 信頼性試験としての高温と低温とを繰り返すヒートサイクル条件下で、パッケー ジ基板側とマザーボード又はドータボード側との熱膨張率差により、基板に反り や凹凸が生じた場合、パッド16と層間樹脂絶縁層200との界面で破壊が起こ り、導電性接続ピン120がパッド16と共に基板から剥離する問題が見られた 。また、当該導電性接続ピンを介してパッケージ基板をマザーボードへ装着する 際、導電性接続ピンの位置と接続すべきマザーボードのソケットとの間に位置ず



[0006]

本発明は、このような問題点を解決するために提案されたものであって、ヒートサイクル条件下や、実装の際に、応力が集中し難い導電性接続ピン、および、 係る応力が加わっても導電性接続ピンが剥離し難い樹脂パッケージ基板を提供するものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは鋭意検討した結果、本発明に到達した。すなわち、請求項1の発明は、導電性接続ピンに関するもので、パッケージ基板に固定されて他の基板との接続を得るための導電性接続ピンにおいて、前記導電性接続ピンが柱状の接続部と板状の固定部よりなり、前記柱状の接続部に他の部分の直径よりも小さいくびれ部が形成されていることを技術手段としている。

[0008]

請求項1の発明では、導電性接続ピンの柱状の接続部に他の部分の直径よりも 小さいくびれ部が設けられているので、ピンに曲がりやすさが付与される。その ため、導電性接続ピンに応力が加わった際には、接続部がくびれ部で曲がるので その応力が吸収され、導電性接続ピンを基板から剥離しにくくする。

[0009]

この導電性接続ピンには、板状の固定部とこの板状の固定部の略中央に突設された柱状の接続部とからなる、いわゆるT型ピンが好適に用いられる。

板状の固定部は、パッドとなる導体層に導電性接着剤を介して固定される部分であって、パッドの大きさに合わせて円形状や多角形状など適宜に形成される。また、接続部は、他の基板に取り付けられる部分であって、その電子部品に挿入可能であれば形状に特に問題はなく、円柱・角柱・円錐・角錐など何でもよい。この接続部は通常一のピンに対し基本的に1本であるが、2本以上設けても特に問題はなく、実装される他の基板に応じて適宜に形成してよい。

[0010]

この導電性接続ピンは、板状の固定部の直径が0.5~2.0mmの範囲、柱状の接続部の直径が0.1から0.8mmで、長さが1~10mmで形成することが好ましく、固定されるパッケージ基板や装着される他の基板の種類などにより適宜選択される。

[0011]

くびれ部は、この接続部の途中に設けられており、他の部分よりも細く形成されている。このくびれ部の太さは、導電性接続ピンを構成する材質や導電性接続ピンの大きさなどによって異なるが、その直径が、接続部そのものの直径の50%以上98%以下とすることが重要である。くびれ部の直径が他の部分の直径の50%より小さいと、接続部の強度が不充分となり、パッケージ基板を装着した際に変形したり折れたりすることがある。また、くびれ部の直径が他の部分の直径の98%を超えると、接続部に所期の可撓性を付与することができず、応力の吸収効果が得られない。また、くびれ部は、複数形成されていてもよい(図8(B))。

[0012]

本発明の導電性接続ピンを構成する材質は、金属であれば特に限定はなく、金・銀・銅・ニッケル・コバルト・スズ・鉛などの中から少なくとも一種類以上の金属で形成するのがよい。鉄合金である、商品名「コバール」(Ni-Co-Feの合金)やステンレス、銅合金であるリン青銅は好ましい材質である。電気的特性が良好で、しかも導電性接続ピンへの加工性にも優れているからである。特に、リン青銅は、高い可撓性を有するため、応力吸収のために好適である。

[0013]

また、請求項3の発明では、導体層を設けた基板上に他の基板との接続を得る ための導電性接続ピンが固定されてなるパッケージ基板において、前記導電性接 続ピンは、柱状の接続部と板状の固定部よりなり、前記柱状の接続部に他の部分 の直径よりも小さいくびれ部が形成されており、前記導体層の一部または全部に 前記導電性接続ピンを固定するためのパッドが形成され、前記パッドに前記導電 性接続ピンの固定部が導電性接着剤を介して固定されていることを技術手段とし ている。従って、このパッケージ基板を外部の電子部品などに取り付ける際など に、たとえば導電性接続ピンと他の基板との間に位置のずれなどがあって当該導電性接続ピンに応力が加わった場合には、接続部がくびれ部を介して撓むことでその応力を吸収するので、導電性接続ピンが基板から剥離するのを防止でき、信頼性の高いパッケージ基板となる。

[0014]

請求項3のパッケージ基板は、導電性接続ピンが固定されるパッドを、当該パッドを部分的に露出する開口部が設けられた有機樹脂絶縁層で覆ってもよい。それにより、先に述べた導電性接続ピンへの応力の集中や基板の変形などが生じた場合でも、パッドが有機樹脂絶縁層で押さえられており、基板から剥離するのを防止できる。特に金属性のパッドと層間樹脂絶縁層という全く異なる材質同士の接着で充分な接着力を得難い場合でも、パッド表面を有機樹脂絶縁層で覆うことで高い剥離強度を付与することができる。

[0015]

パッドを有機樹脂絶縁層で覆う場合、そのパッドの大きさは、当該パッドが現れる有機樹脂絶縁層の開口部よりやや大きくすることが重要である。それにより、パッドを開口部から部分的に露出させることができる。すなわち、パッドの周縁が有機樹脂絶縁層で被われるのである。パッドの大きさは、その直径が、当該パッドを露出する有機樹脂絶縁層の開口部の直径の、1.02から100倍とするのがよい。パッドの直径が、開口部の直径の1.02倍未満では、パッドの周囲を有機樹脂絶縁層で確実に押さえることができず、導電性接続ピンの剥離を防止できない。また、100倍より大きくすると、導体層の高密度化を阻害するからである。具体的には、有機樹脂絶縁層に設けられた開口部の直径を100から1,500μmとしたとき、パッドの直径を110から2,000μmとする。

[0016]

請求項7の発明は、導体層と層間樹脂絶縁層とが交互に積層された構造を少なくとも一つ以上有するビルドアップ基板に、他の基板との電気的接続を得るための導電性接続ピンが固定されてなるパッケージ基板において、前記導電性接続ピンは、柱状の接続部と板状の固定部よりなり、前記柱状の接続部に他の部分の直径よりも小さいくびれ部が形成されており、前記ビルドアップ基板の最外層の導

体層の一部または全部に、前記導電性接続ピンを固定するためのパッドが形成され、前記パッドは、バイアホールを介して内層の導体層に接続されるとともに、 前記パッドに導電性接続ピンが導電性接着剤を介して固定されていることを技術 手段としている。

[0017]

請求項7の発明では、導電性接続ピンの接続部にくびれ部を設けて曲がり易くし、しかもその導電性接続ピンを固定するパッドがバイアホールを介して内層の導体層と接合しているので、導電性接続ピンの曲がり易さで応力を吸収する効果に加え、パッドと基板との接触面積が増えて両者を強固に接合することができる。また、先述したように、請求項3の発明では、導電性接続ピンが固定されるパッドとそのパッドが接着されている層間樹脂絶縁層は、異素材間の接着となっているのに対し、本請求項で示した発目では、パッドは内層の導体層と接続している。そのため、両者は金属同士の接続となってより確実に密着するとともに、パッドの剥離強度が高められる。

[0018]

また、パッドを一つ以上のバイアホールを介して内層の導体層と接続してもよい。パッドの接着面積をさらに増して、より剥離しにくい構造とすることができるからである。なお、パッドをバイアホールを介して内層の導体層に接続する場合、バイアホールはそのパッドの周辺部分に配置するのが接続性を高める上で効果的である。そのため、バイアホールをリング状とし、そのリングを覆うようにパッドを設けてもよい。

[0019]

さらに、ビルドアップ基板において、導電性接続ピンが固定されるパッドは、2層以上のバイアホールを介して内層の導体層と接続するように構成してもよく、パッケージ基板の形状や種類によっては、この二層以上のバイアホールがそれぞれ一つ以上のバイアホールよりなってもよい。いずれも、パッドの表面積が増しので、接着強度を高めるために有効だからである。パッドが設けられるバイアホールを、パッドを部分的に露出させる開口部を有する有機樹脂絶縁層によって被覆すれば、パッドの剥離を確実に防止することができる。



請求項8の発明では、導体層が形成されたコア基板に導体層と層間樹脂絶縁層が交互に積層された構造を少なくとも一つ以上有するビルドアップ基板に、他の基板との電気的接続を得るための導電性接続ピンが固定されたパッケージ基板において、前記導電性接続ピンは、柱状の接続部と板状の固定部よりなり、前記柱状の接続部に他の部分の直径よりも小さいくびれ部が形成されており、前記ビルドアップ基板の最外層の導体層の一部または全部に、前記導電性接続ピンを固定するためのパッドが形成され、前記パッドはバイアホールを介して前記コア基板の導体層に接続されるとともに、当該パッドには導電性接続ピンが導電性接着剤を介して固定されていることを技術手段とする。

[0021]

コア基板上の導体層は、コア基板となる樹脂基板の表面に粗化面(マット面)を介して強固に密着しており、このような導体層にパッドを接続させることにより、パッドが層間樹脂絶縁層から一層剥離しにくくなる。なお、パッドを一つ以上のバイアホールおよび二層以上のバイアホールを介して内層の導体層に接合する場合も、その内層の導体層はコア基板に設けたものであってよい。

[0022]

請求項9の発明は、導体層を備えたスルーホールが形成されてなるコア基板の両面に、導体層と層間樹脂絶縁層とが交互に積層された構造を少なくとも一つ以上有するビルドアップ基板に、他の基板との電気的接続を得るための導電性接続ピンが固定されたパッケージ基板において、前記導電性接続ピンは、柱状の接続部と板状の固定部よりなり、前記柱状の接続部に他の部分の直径よりも小さいくびれ部が形成されており、前記ビルドアップ基板の、最外層の導体層の一部または全部に、前記導電性接続ピンを固定するためのパッドが形成され、前記パッドは、前記スルーホールの導体層とバイアホールを介して接続されているとともに、当該パッドには導電性接続ピンが導電性接着剤を介して固定されていることを技術手段とする。

[0023]

このパッケージ基板によれば、導電性接続ピンと当該導電性接続ピンが設けら

れる側の反対側面にある他の基板との配線長を短くすることができる。具体的には、コア基板において、スルーホール周辺のランドおよびスルーホール内に充填された樹脂充填材にバイアホールを介してパッドを接続する。また、スルーホールを導体層で被う、いわゆる蓋めっきを行い、この導体層に、バイアホールを介してパッドを接続する。さらに、スルーホールのランドのみにバイアホールを介してパッドを接続してもよい。

[0024]

【発明の実施の形態】

次に、図1ないし図8に従い、第1実施例のパッケージ基板を、ビルドアップ 基板の製造方法とともに説明する。以下の方法は、セミアディティブ法によるも のであるが、フルアディティブ法を採用してもよい。

[0025]

[第1実施例]

(1) まず、基板の表面に導体層を形成したコア基板を作成する。コア基板としては、ガラスエポキシ基板、ポリイミド基板、ビスマレイミドートリアジン樹脂基板などの樹脂絶縁基板の両面に銅箔8を貼った銅張積層板を使用することができる(図1 (a) 参照)。銅箔8は、片面が粗化面(マット面)となっており、樹脂基板に強固に密着している。この基板に、ドリルで貫通孔を設けた後、無電解めっきを施しスルーホール9を形成する。無電解めっきとしては銅めっきが好ましい。引き続き、めっきレジストを形成し、エッチング処理して導体層4を形成する。なお、銅箔の厚付けのためにさらに電気めっきを行ってもよい。この電気めっきにも銅めっきが好ましい。また、電気めっきの後、導体層4の表面およびスルーホール9の内壁面を粗面4a,9aとしてもよい(図1(b)参照)。

[0026]

この粗化処理方法としては、例えば、例えば黒化(酸化)-還元処理、有機酸と第2銅錯体の混合水溶液によるスプレー処理、Cu-Ni-Pの針状合金めっきによる処理などが挙げられる。

[0027]

次に、得られた基板を水洗してから乾燥する。その後、基板表面の導体層4間 およびスルーホール9内に樹脂充填材10を充填し、乾燥させる(図1(c)) 。引き続き、基板両面の不要な樹脂充填材10をベルトサンダー研磨などで研削 し、導体層4を露出させ、樹脂充填材10を本硬化させる。導体層4間およびス ルーホール9による凹部を埋めて基板を平滑化する(図1(d)参照)。

[0028]

次に、露出した導体層4の表面に粗化層11を再度設ける(図2(a)参照)。なお、図2(a)中の円で示す部分は、粗化層11が設けられた導体層4を拡大して示している。この粗化層11は、先に述べたようなCu-Ni-Pの針状あるいは多孔質状合金層により形成されていることが望ましいが、この他にも黒化(酸化)-還元処理やエッチング処理で粗化層を形成することもできる。Cu-Ni-P針状または多孔質状合金層による場合、荏原ユージライト製商品名「インタープレート」により、また、エッチング処理は、メック社製商品名「MECetch Bond」により行うことが望ましい。

[0029]

(2) 上記(1)で作成した導体層4を有する配線基板の両面に樹脂層2a、2bからなる樹脂絶縁層2を形成する(図2(b)参照)。この樹脂絶縁層2 は後述するようにパッケージ基板の層間樹脂絶縁層200として機能する。

上記樹脂絶縁体層(以下、層間樹脂絶縁層200)を構成する材料としては、例えば、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂またはこれらの複合樹脂などが挙げられる。層間樹脂絶縁層2として、無電解めっき用接着剤を用いることが望ましい。この無電解めっき用接着剤は、硬化処理された酸あるいは酸化剤に可溶性の耐熱性樹脂粒子が、酸あるいは酸化剤に難溶性の未硬化の耐熱性樹脂中に分散されてなるものが最適である。後述するように酸、酸化剤の溶液で処理することにより、耐熱性樹脂粒子が溶解除去されて、表面に蛸つぼ状のアンカーからなる粗化面を形成できるからである。

[0030]

上記無電解めっき用接着剤において、特に硬化処理された前記耐熱性樹脂粒子としては、①平均粒径が10μm以下の耐熱性樹脂粉末、②平均粒子径が相対的

に大きな粒子と平均粒子径が相対的に小さな粒子を混合した粒子が望ましい。これらはより複雑なアンカーを形成できるからである。

[0031]

使用できる耐熱性樹脂としては、例えば、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂と熱可塑性樹脂との複合体等が挙げられる。複合させる熱可塑性樹脂として、ポリエーテルスルフォン(PES)、ポリサルフォン(PSF)、ポリフェニレンサルフォン(PPES)、ポリフェニレンサルフォン(PPES)、ポリフェニレンサルファイド(PPES)、ポリフェニルエーテル(PPE)、ポリエーテルイミド(PI)などを使用できる。また、酸や酸化剤の溶液に溶解する耐熱性樹脂粒子としては、たとえば、エポキシ樹脂(特にアミン系硬化剤で硬化させたエポキシ樹脂がよい)、アミノ樹脂などが挙げられる。

[0032]

(3) 次に、層間樹脂絶縁層2に、導体層4との電気接続を確保するためのバイアホール形成用開口6を設ける(図2(c)参照)。

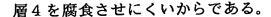
上述した無電解めっき用接着剤を用いる場合には、バイアホール形成のための 円パターンが描画されたフォトマスクを載置し、露光、現像処理してから熱硬化 することで開口6を設ける。一方、熱硬化性樹脂を用いた場合には、熱硬化した のちレーザー加工することにより、上記層間樹脂絶縁層にバイアホール用の開口 6を設ける。

[0033]

(4) 次に、バイアホール形成用開口6を設けた層間樹脂絶縁層2の表面を粗化する(図2(d)参照)。層間樹脂絶縁層2に無電解めっき用接着剤を用いた場合、この無電解めっき用接着剤層の表面に存在する耐熱性樹脂粒子を酸または酸化剤で溶解除去することにより、無電解めっき用接着剤層2の表面を粗化して、蛸壺状のアンカーを設ける。

[0034]

ここで、上記酸としては、例えば、リン酸、塩酸、硫酸などの鉱酸、または蟻酸や酢酸などの有機酸を用いることができる。特に、有機酸を用いるのが望ましい。これは、粗化処理した場合に、バイアホール用開口 6 から露出する金属導体



一方、上記酸化剤としては、クロム酸、過マンガン酸塩(過マンガン酸カリウムなど)の水溶液を用いることが望ましい。

[0035]

前記粗化は、表面の最大粗度RmaxO. $1\sim 20~\mu$ mがよい。厚すぎると粗化面自体が損傷、剥離しやすく、薄すぎると密着性が低下するからである。

[0036]

(5) 次に、層間樹脂絶縁層2の表面を粗化した配線基板に、触媒核を付与する。触媒核の付与には、貴金属イオンや貴金属コロイドなどを用いることが望ましく、一般的には塩化パラジウムやパラジウムコロイドを使用する。なお、この触媒核を固定するために、加熱処理を行うことが望ましい。このような触媒核にはパラジウムが好適である。

[0037]

(6) 続いて、粗化し触媒核を付与した層間樹脂絶縁層2の全面に無電解めっきを施し、無電解めっき膜12を形成する(図3(a)参照)。この無電解めっき膜12の厚みは、0.1~5μmが好ましい。

[0038]

次に、無電解めっき膜12の表面にめっきレジスト3を形成する(図3(b)参照)。形成した無電解めっき膜12上に感光性樹脂フィルム(ドライフィルム)をラミネートし、この感光性樹脂フィルム上に、めっきレジストパターンが描画されたフォトマスク(ガラス基板がよい)を密着させて載置し、露光し現像処理することによりめっきレジスト3を形成できる。

[0039]

(7) 次に、電気めっきを施し、無電解めっき膜12上のめっきレジスト非形成部に電気めっき膜を形成し、導体層5とバイアホール7を形成する。その厚みは $5\sim20~\mu$ mがよい。この電気めっきには、銅めっきが好ましい。

また、電気めっき後に、電解ニッケルめっき、無電解ニッケルめっき、またはスパッタから選ばれる少なくとも1の方法により、ニッケル膜14を形成する(図3 (c) 参照)。このニッケル膜14上にはCu-Ni-Pからなる合金めっ

きが析出しやすいからである。また、ニッケル膜はメタルレジストとして作用するため、その後の工程でも過剰エッチングを防止するという効果を奏する。

[0040]

(8) 続いて、めっきレジスト3を除去した後、そのめっきレジスト下に存在していた無電解めっき膜12を、硫酸と過酸化水素の混合液や過硫酸ナトリウム、過硫酸アンモニウムなどの水溶液からなるエッチング液にて除去し、無電解めっき膜12、電解めっき膜13及びニッケル膜14の3層からなる独立した導体層5とバイアホール7を得る(図3(d)参照)。なお、非導体部分に露出した粗化面上のパラジウム触媒核は、クロム酸、硫酸過水などにより溶解除去する。

[0041]

(9) 次に、導体層5とバイアホール7の表面に粗化層11を設け、さらに層間樹脂絶縁層2として先に述べた無電解めっき用接着剤の層を形成する。(図4(a)参照)。

[0042]

(10) この層間樹脂絶縁層2に、バイアホール用開口6を設けるとともに、 層間樹脂絶縁層2の表面を粗化する。(図4 (b) 参照)。

[0043]

(11) つづいて、この粗化した層間樹脂絶縁層2の表面に触媒核を付与した後、無電解めっき膜12を形成する(図4(c)参照)。

[0044]

(12) 無電解めっき膜12の表面にめっきレジスト3を形成し、先に述べたように、めっきレジスト3の非形成部に電気メッキ膜13、ニッケルめっき膜14を形成する(図4(d)参照)。

[0045]

(13) めっきレジスト3を除去し、めっきレジスト下の無電解めっき膜12を除去し、導体層(導電性接続ピンを固定するパッド16となる導体層を含む) 5、およびバイアホール7を設け、片面3層の6層のビルドアップ基板を得る(図5参照)。

[0046]

(14) このようにして得られたビルドアップ基板の導体層 5 及びバイアホール7 に粗化層 1 1 を形成し、パッド 1 6 を露出させる開口部 1 8 を有する有機樹脂絶縁層 1 5 で被覆する(図 6 参照)。有機樹脂絶縁層の厚さは 5 ~ 4 0 μ mがよい。薄すぎると絶縁性能が低下し、厚すぎると開口し難くなるうえ半田と接触し、クラックなどの原因となるからである。

[0047]

この有機樹脂絶縁層を構成する樹脂としては、種々のものが使用でき、例えば、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールA型エポキシ樹脂のアクリレート、ノボラック型エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂のアクリレートをアミン系硬化剤やイミダゾール硬化剤で硬化させた樹脂を使用できる。

[0048]

このような構成の有機樹脂絶縁層は、鉛のマイグレーション(鉛イオンが、有機樹脂絶縁層内を拡散する現象)が少ないといった利点を有する。しかも、この有機樹脂絶縁層は、耐熱性、耐アルカリ性に優れ、ハンダなどの導電性接着剤が溶融する温度(200℃前後)でも劣化しないし、ニッケルめっきや金めっきのような強塩基性のめっき液で分解することもない。

[0049]

ここで、上記ノボラック型エポキシ樹脂のアクリレートとしてはフェノールノボラックやクレゾールノボラックのグリシジルエーテルをアクリル酸やメタクリル酸などと反応させたエポキシ樹脂などを用いることができる。上記イミダゾール硬化剤は、25℃で液状であることが望ましい。液状であれば均一混合できるからである。

[0050]

このような液状イミダゾール硬化剤としては、 1 ーベンジルー 2 ーメチルイミダゾール (品名: 1 B 2 M Z)、 1 ーシアノエチルー 2 ーエチルー 4 ーメチルイミダゾール (品名: 2 E 4 M Z - C N)、 4 ーメチルー 2 ーエチルイミダゾール (品名: 2 E 4 M Z) を用いることができる。

[0051]

このイミダゾール硬化剤の添加量は、上記有機樹脂絶縁層の総固形分に対して

1から10重量%とすることが望ましい。この理由は、添加量がこの範囲内にあれば均一混合がしやすいからである。上記有機樹脂絶縁層の硬化前組成物は、溶媒としてグリコールエーテル系の溶剤を使用することが望ましい。かかる組成物を用いた有機樹脂絶縁層は遊離酸素が発生せず、パッド表面を酸化させず、また人体に対する有害性も少ないからである。

[0052]

上記グリコールエーテル系溶剤としては、望ましくはジエチレングリコールジメチルエーテル(DMDG)およびトリエチレングリコールジメチルエーテル(DMTG)から選ばれるいずれか少なくとも1種を用いる。これらの溶剤は、30~50℃程度の加温により、反応開始剤であるベンゾフェノンやミヒラーケトンを完全に溶解させることができるからである。

このグリコールエーテル系の溶媒は、有機樹脂絶縁層の組成物の全重量に対して10~40重量%がよい。

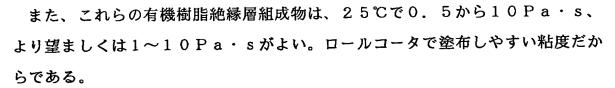
[0053]

以上説明したような有機樹脂絶縁層の組成物には、そのほかに各種消泡剤やレベリング剤、耐熱性や耐塩基性の改善と可撓性付与のために熱硬化性樹脂、解像度改善のために感光性モノマーなどを添加することができる。例えば、レベリング剤としてはアクリル酸エステルの重合体からなるものがよい。また、開始剤としてはチバガイギー社製のイルガキュアI907、光増感剤としては日本化薬社製のDETX-Sがよい。さらに、有機樹脂絶縁層の組成物には色素や顔料を添加してもよい。配線パターンを隠蔽できるからである。この色素としてはフタロシアニングリーンを用いることが望ましい。

[0054]

添加成分としての上記熱硬化性樹脂としては、ビスフェノール型エポキシ樹脂を用いることができる。このビスフェノール型エポキシ樹脂には、ビスフェノールA型エポキシ樹脂とビスフェノールF型エポキシ樹脂があり、耐塩基性を重視する場合には前者が、低粘度化が要求される場合(塗布性を重視する場合)には後者がよい。

[0055]



[0056]

(15) 前記開口部18内に金めっき膜19の形成を行った後、パッケージ基板の下面側(ドータボード、マザーボードとの接続面)となる開口部16内に、導電性接着剤17としてハンダペーストを印刷する。さらに、接続部111にくびれ113が設けられた導電性接続ピン100を適当なピン保持装置に取り付けて支持し、導電性接続ピン100の固定部101を開口部16内の導電性接着剤17に当接させて、200~220℃でリフロを行い、導電性接続ピン100を導電性接着剤17に固定する(図7参照)。また、図7において円で囲んで示した導電性接続ピン100を設けたパッド部分を、図8(A)に拡大して示した。

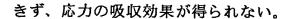
なお、パッケージ基板310において、上面側の開口18には、ICチップなどの部品に接続可能なハンダバンプ230を設けた。

[0057]

本発明に用いられる導電性接続ピン100は、板状の固定部101とこの板状の固定部101の略中央に突設された柱状の接続部102とからなる、いわゆる T型ピンが好適に用いられる。板状の固定部101は、パッド16となるパッケージ基板の最外層の導体層5に導電性接着剤17を介して固定される部分であって、パッドの大きさに合わせた円形状や多角形状など適当に形成される。また、接続部102の形状は、他の基板の端子など接続部に挿入可能な柱状であれば問題なく、円柱・角柱・円錐・角錐など何でもよい。

[0058]

くびれ部103は、接続部102の途中に設けられており、他の部分よりも細く形成されている。このくびれ部103の太さは、その直径が、接続部そのものの直径の50%以上98%以下とすることが重要である。くびれ部の直径が他の部分の直径の50%より小さいと、接続部の強度が不充分となり、パッケージ基板を装着した際に変形したり折れたりすることがある。また、くびれ部の直径が他の部分の直径の98%を超えると、接続部に所期の可撓性を付与することがで



[0059]

本発明の導電性接続ピンを構成する材質は、金属であれば特に限定はなく、金・銀・銅・ニッケル・コバルト・スズ・鉛などの中から少なくとも一種類以上の金属で形成するのがよい。鉄合金である、商品名「コバール」(Ni-Co-Feの合金)やステンレス、銅合金であるリン青銅は好ましい材質である。電気的特性が良好で、しかも導電性接続ピンへの加工性にも優れているからである。特に、リン青銅は、高い可撓性を有するため、応力吸収のために好適である。

[0060]

導電性接続ピン100において、柱状の接続部102は直径が0.1~0.8 mmで長さが1.0~10mm、板状の固定部101の直径は0.5~2.0mmの範囲とすることが望ましく、パッドの大きさや装着されるマザーボードのソケット等の種類などによって適宜に選択される。

[0061]

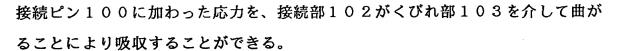
本発明のパッケージ基板に用いられる導電性接着剤17としては、ハンダ (スズー鉛、銀ースズー銅)、導電性樹脂、導電性ペーストなどを使用することができ、ハンダで形成するのが最も好ましい。導電性接続ピン100との接着強度に優れているとともに、接着作業がやりやすいからである。

[0062]

導電性接着剤17をハンダで形成する場合、パッケージ基板の製造に一般的に用いられるSn:Pb=1:9~4:6などの組成よりなるハンダを使用するのが好適である。用いられるハンダの融点は、280℃未満のものが望ましい。280℃を超えると作業性に問題があるだけでなく、層間樹脂絶縁層200や有機樹脂絶縁層15に使用される樹脂が溶解して、これらの絶縁層や導体層の剥離、断線などを生じることがある。

[0063]

図8(A)、図8(B)から理解されるように、この導電性接続ピン100は、接続部102にくびれ部103が設けられているので、可撓性に富んで曲がり易くなっており、パッケージ基板をマザーボード等へ取り付ける際などに導電性



[0064]

a.第1改変例

第1改変例のパッケージ基板311のパッド16は、図9に示すように、当該パッド16を部分的に露出させる開口部18が形成された有機樹脂絶縁層(スルーホール層)15により被覆されており、開口部18から露出したパッド16に導電性接着剤17を介して導電性接続ピン100の固定部101が固定されている。図から理解されるように、この有機樹脂絶縁層15は、パッド16の周囲を押さえるように被覆しているので、ヒートサイクル時や、パッケージ基板をマザーボードへ装着する際などに、導電性接続ピン100に応力が加わっても、パッド16の破壊および層間樹脂絶縁層15との剥離を防止できる。なお、ここでは、層間樹脂絶縁層が形成された多層プリント配線板から成るパッケージ基板を例示したが、1枚の基板のみからなるパッケージ基板にも第1実施例の構成は適用可能である。

[0065]

[第2実施例]

このパッケージ基板312は、基本的には図7および図8を参照して上述した 第1実施例と同じであるが、導電性接続ピン100を固定するパッド16を、バ イアホール7を介して、層間樹脂絶縁層200の内層の導体層160に接続した 。そして、有機樹脂絶縁層15によってパッド16の一部を被覆した(図10参 照)。製造工程は、(1)から(14)までは第1実施例と全く同じである。

- (15) バイアホール7内に導電性接着剤となるハンダペースト17を充填 する。有機樹脂絶縁層15の表面にマスク材(図示せず)を配置し密着させてハ ンダペーストを印刷し、200℃でリフロした。
 - (16) 導電性接続ピンのパッドへの固定は、第1実施例と同じである。

第2実施例では、導電性接続ピン110のくびれ部113による応力の吸収性 の高さに加え、バイアホール7によってパッド16と基板との接着面積が大きく なっているので、パッド16の剥離強度を高めることができる。また、内層の導 体層160は、金属層であるので、同じ金属製のパッド16の接着性も良好で、 剥がれ難い構造となっている。しかもその表面を有機樹脂絶縁層15で覆ってい るので、パッド16と基板との剥離強度に優れている。

[0066]

なお、パッドが接続する内層の導体層は、コア基板1に設けられていてもよい。 先に述べたように、コア基板上の導体層は粗化面を介してコア基板と強固に密着しているので、パッドをより剥離し難くすることができる。

[0067]

a. 第1改変例

基本的に第2実施例と同じであるが、一の導電性接続ピン100を固定するパッド16を、複数のバイアホール7を介して、層間樹脂絶縁層200の内層の導体層160に接続したパッケージ基板313である(図11(A)参照)。本例では、図11(B)に示すように、バイアホール7を円形に6つ配置し、各バイアホール7を覆うようにパッド16を形成した。図11(B)は、図11(A)をバイアホール7側から見たB矢視図である。なお、図11(B)に示すバイアホール7の位置では、断面で示した場合、図11(A)のような3つのバイアホール7は現れないが、図示の便宜上、向こう側のバイアホールを点線で示してある。

[0068]

b. 第2改変例

基本的に第1改変例と同じであるが、バイアホール7の形状を、図12(B)で示すようなリング状としたパッケージ基板314である(図12参照)。図12(B)は図12(A)のB矢視図である。

[0069]

第1改変例では複数のバイアホール7によって、また、第2改変例ではリング 状のバイアホール7によって、基板との接着面積が更に大きくなっている。

[0070]

c. 第3改変例

基本的に図11に示して説明した第1改変例と同じであるが、内層の層間樹脂

絶縁層200にも円形に配置した複数のバイアホール7を設け、パッド16が設けられる外層側バイアホール7と内層のバイアホール7とを接合したパッケージ基板315である(図13(A)、図13(B)参照)。このパッケージ基板315では、複数のバイアホール7同士を結合しているので、パッド16が極めて剥がれ難くなっている。

[0071]

なお、先に述べたように、これら各改変例においても、パッドが設けられる内層の導体層はコア基板1に形成されたものであることが望ましい。コア基板上の導体層は、コア基板となる絶縁基板と粗化面(マット面)を介して強固に密着しており、このようなコア基板上の導体層に接続させることにより、パッド16が層間樹脂絶縁層200から剥離し難くなる。

[0072]

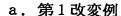
[第3実施例]

基本的に第2実施例の第2改変例と同じであるが、パッド16を接続する内層 の導体層をコア基板1のスルーホール9に設けた導体層(ランド91)とし、有 機樹脂絶縁層15によりパッド16の周縁を覆ったパッケージ基板316である (図14参照)。図示されるように、スルーホール9のランド91およびスルー ホール9内の樹脂充填材10に、バイアホール7を介してパッド16を接続して いる。

[0073]

つまり、パッド16は、バイアホール7を介してコア基板1の導体層に接続していることに特徴がある。コア基板1上の導体層は、コア基板となる絶縁基板と粗化面(マット面)を介して強固に密着しており、このようなコア基板上の導体層に接続させることにより、パッド16が層間樹脂絶縁層200から剥離し難くなる。また、スルーホール9とパッド16とがバイアホール7を介して接続されている。このため、外部端子である導電性接続ピン100と、該導電性接続ピン100該導電性接続ピン100が設けられる側の反対に位置するICチップ(半導体チップ)との間の配線長を短くできる。

[0074]



基本的に第3実施例と同じであるが、スルーホール9に当該スルーホール9を 覆う蓋めっきと呼ばれる導体層90を形成し、この導体層90にバイアホール7 を介してパッド16を接続したパッケージ基板317である(図15参照)。

[0075]

b. 第2改変例

基本的に第3実施例と同じであるが、バイアホールを介して、スルーホール9のランド91のみにパッド16を接続したパッケージ基板318である(図16参照)。これらの例では、パッド16が、コア基板1表面の導体層4と接着して剥がれにくい構造となっているだけでなく、特にスルーホールのランド91と結合させることで、基板裏面側との配線長を短くすることができる。

[0076]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明の導電性接続ピンによれば、柱状の接続部と板状の固定部よりなり、柱状の接続部に他の接続部の直径よりも細いくびれ部が設けられているので、ヒートサイクル時やパッケージ基板の装着時にピンに加わる応力をくびれ部が曲がることで充分に吸収しピンが基板から剥離するのを防止することができる。また、このような導電性接続ピンを用いたパッケージ基板は、導電性接続ピンに応力が集中しにくいため、導電性接続ピンとパッド、およびパッドと基板との接着強度が高く、接続信頼性に優れている。

【図面の簡単な説明】

【図1】

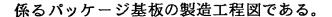
図1(a),図1(b),図1(c),図1(d)は、本発明の第1実施例に 係るパッケージ基板の製造工程図である。

【図2】

図2(a),図2(b),図2(c),図2(d)は、本発明の第1実施例に 係るパッケージ基板の製造工程図である。

【図3】

図3 (a), 図3 (b), 図3 (c), 図3 (d) は、本発明の第1実施例に



【図4】

図4 (a), 図4 (b), 図4 (c), 図4 (d) は、本発明の第1実施例に 係るパッケージ基板の製造工程図である。

【図5】

本発明の第1実施例に係るパッケージ基板の製造工程図である。

【図6】

本発明の第1実施例に係るパッケージ基板の製造工程図である。

【図7】

本発明の第1実施例に係るパッケージ基板の断面図である。

【図8】

図8(A)図7において、導電性接続ピンをパッドに接続した部分を拡大した 断面図であり、図8(B)は、導電性接続ピンの変形例を示す断面図である。

【図9】

本発明の第1実施例の第1改変例に係るパッケージ基板の断面図である。

【図10】

第2実施例に係るパッケージ基板を示す断面図である。

【図11】

第2実施例の第1改変例を示す図であって、図11(A)はパッド部分の断面図、図11(B)は図11(A)のB矢視図である。

【図12】

第2実施例の第2改変例を示す図あって、図12(A)パッド部分の断面図、 図12(B)は図12(A)のB矢視図である。

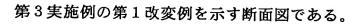
【図13】

図13 (A)、図13 (B)は、第2実施例の第3改変例を示す断面図である

【図14】

第3実施例に係るパッケージ基板の断面図である。

【図15】



【図16】

第3実施例の第2改変例を示す断面図である。

【図17】

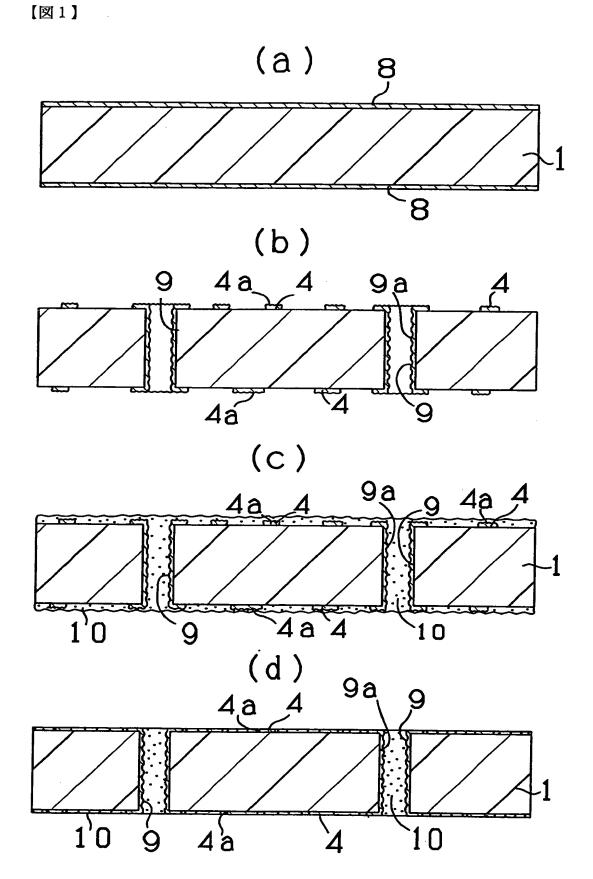
従来技術のパッケージ基板を示す断面図である。

【符号の説明】

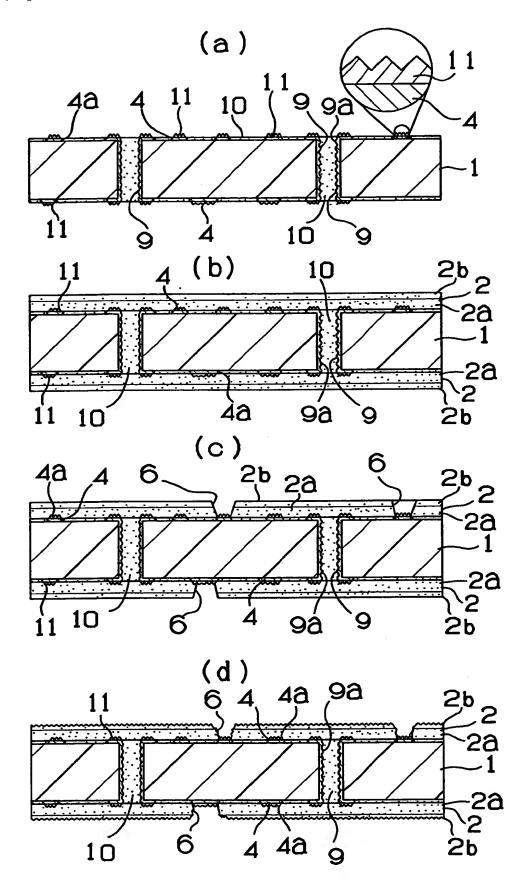
- 1 コア基板
- 2,200 層間樹脂絶縁層
- 3 めっきレジスト
- 4 導体層(下層)
- 4 a 粗化面
- 5 導体層(上層)
- 6 バイアホール用開口
- 7 バイアホール
- 8 銅箔
- 9 スルーホール
- 9 a 粗化面
- 91 スルーホールのランド
- 10 樹脂充填剤
- 11 粗化層
- 12 無電解めっき膜
- 13 電解めっき膜
- 14 ニッケルめっき層
- 15 有機樹脂絶縁層
- 16 パッド
- 17 導電性接着剤
- 100 導電性接続ピン
- 101 固定部
- 102 接続部

- 103 くびれ部
- 310, 311, 312, 313 パッケージ基板
- 314, 315, 316, 317, 318 パッケージ基板

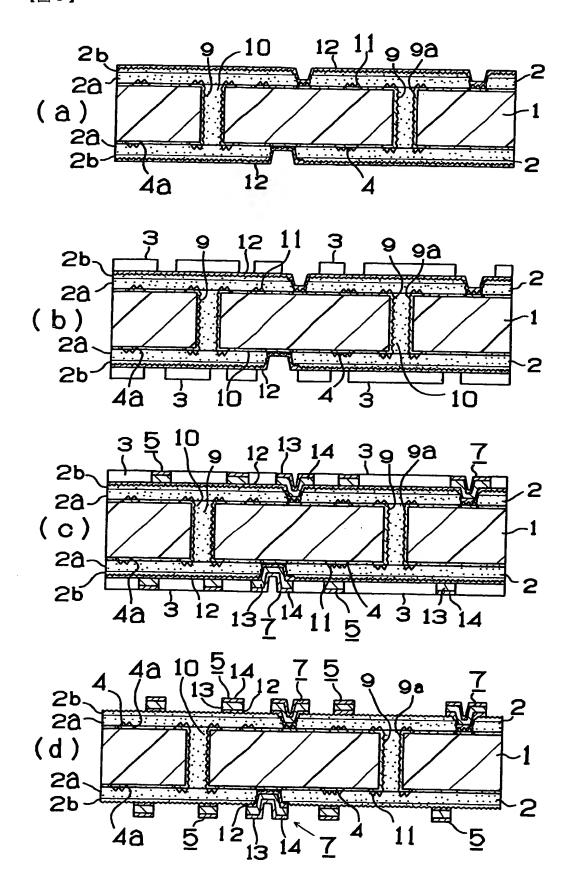
【書類名】図面





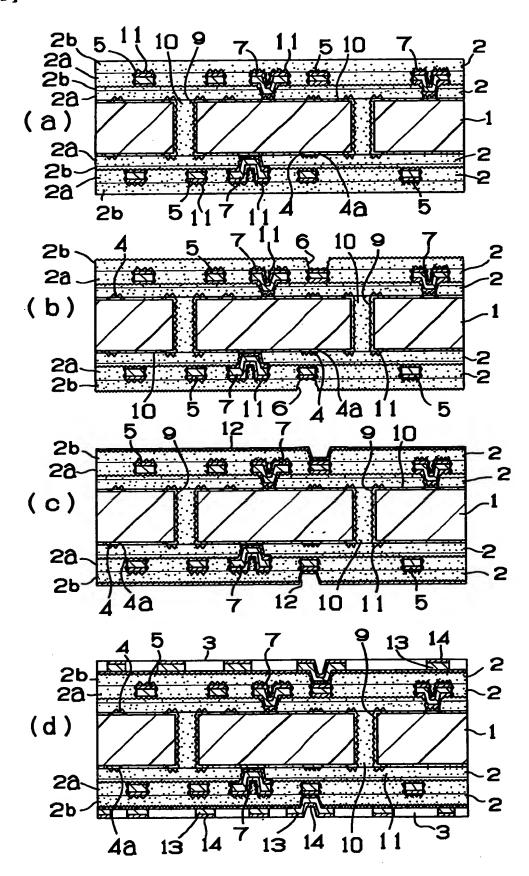






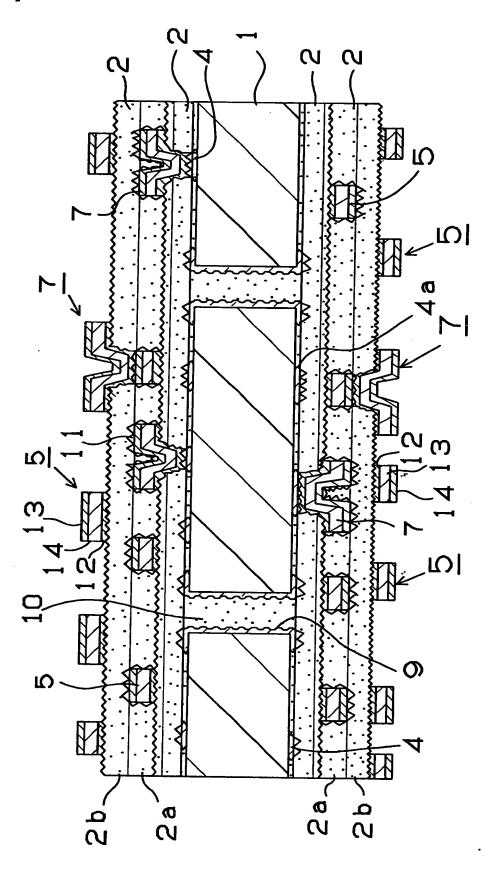


【図4】



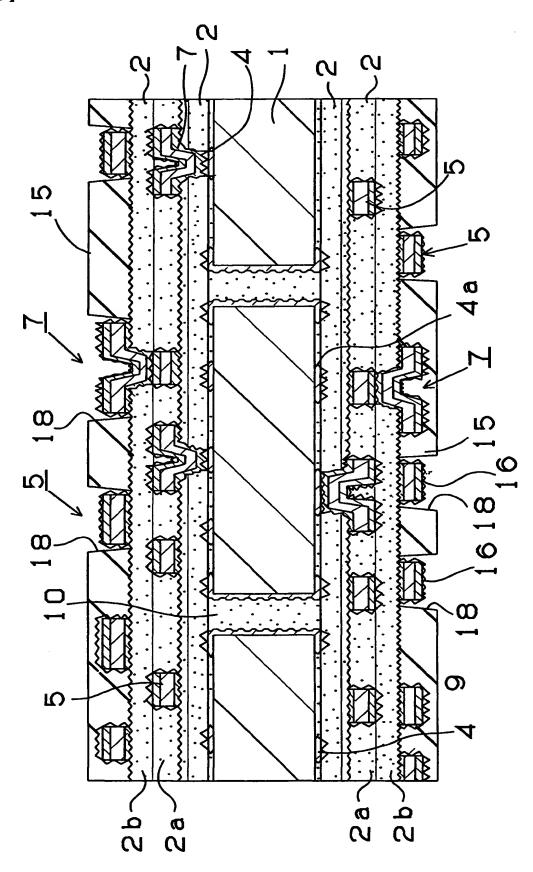


【図5】



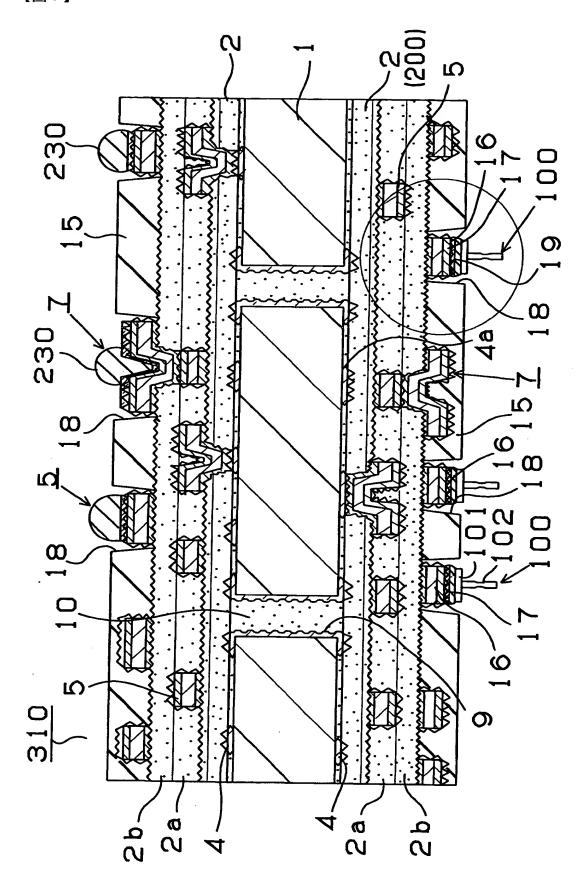


【図6】



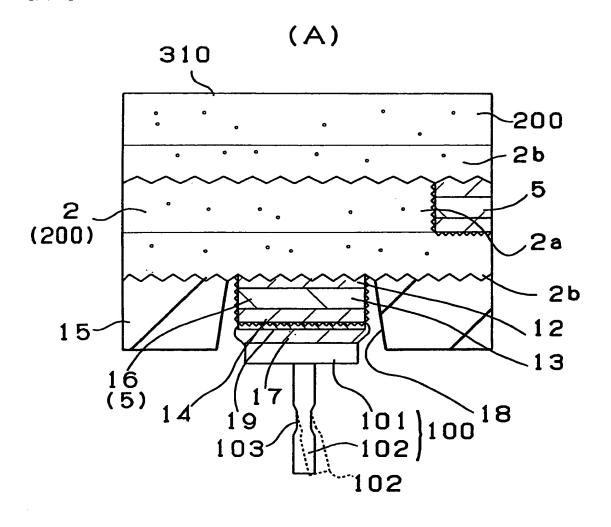


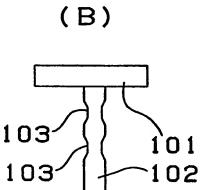
【図7】





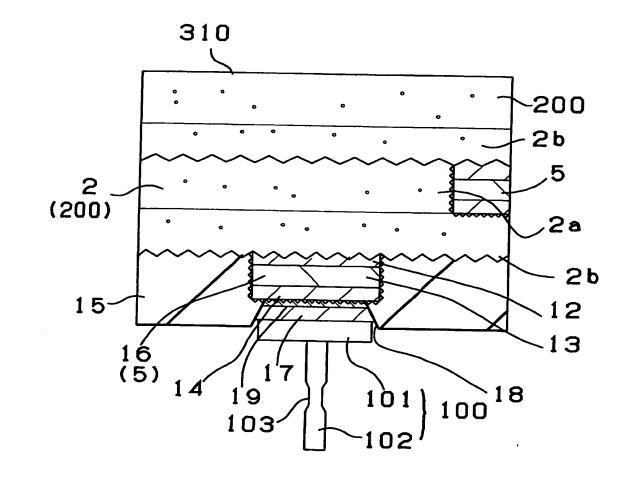
【図8】



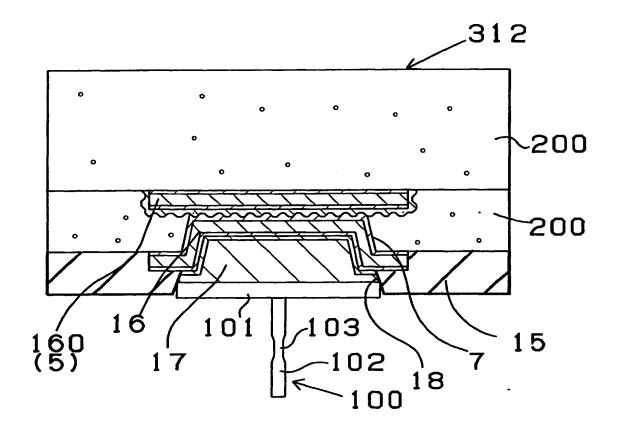


103

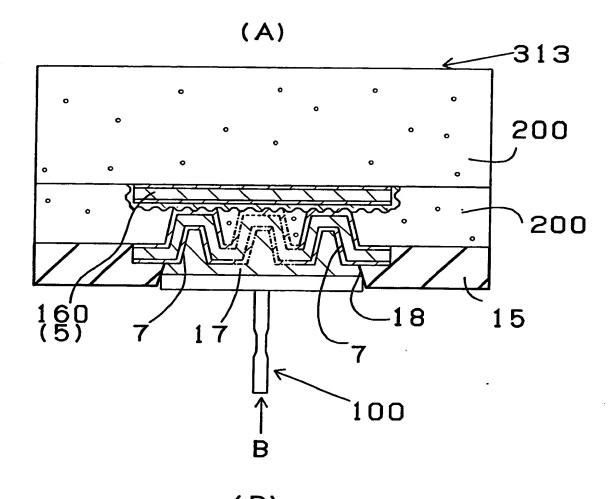


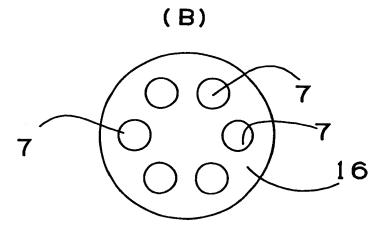






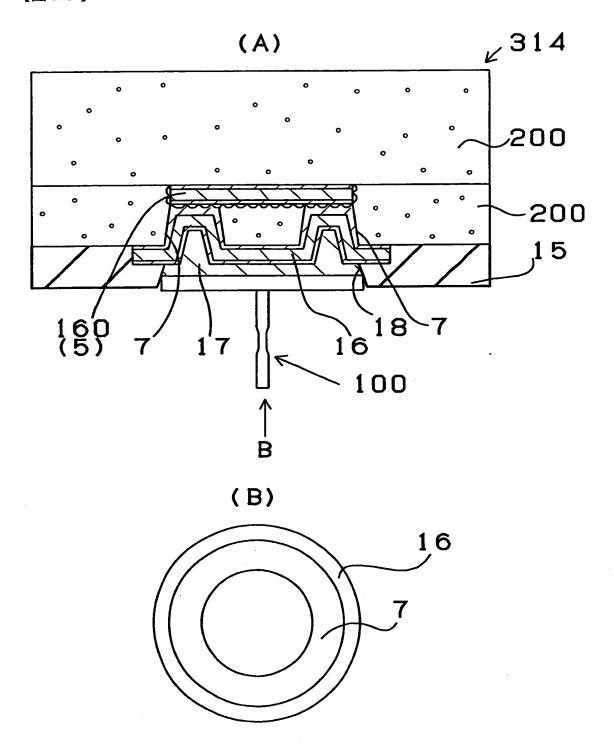






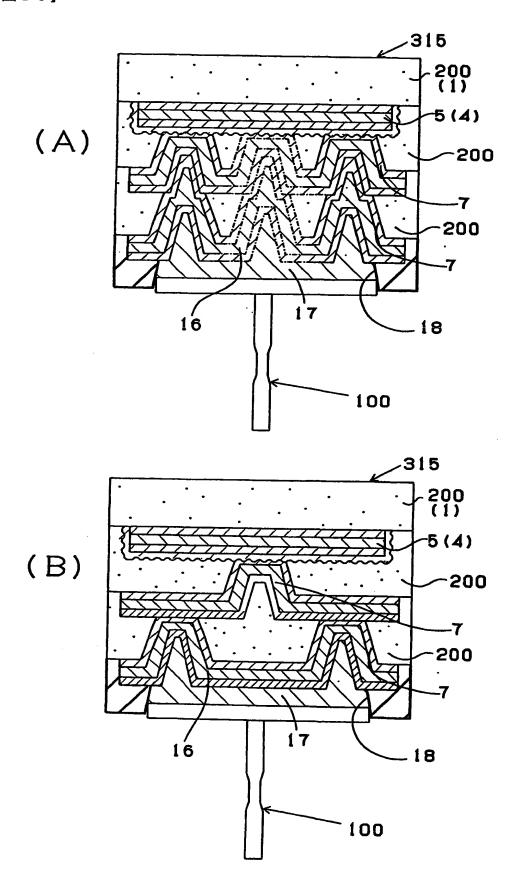


【図12】



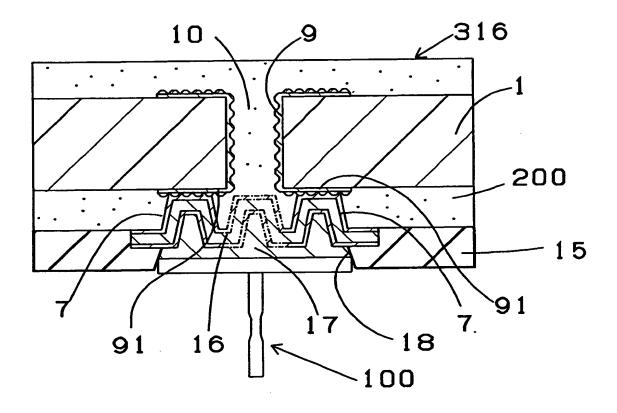


【図13】



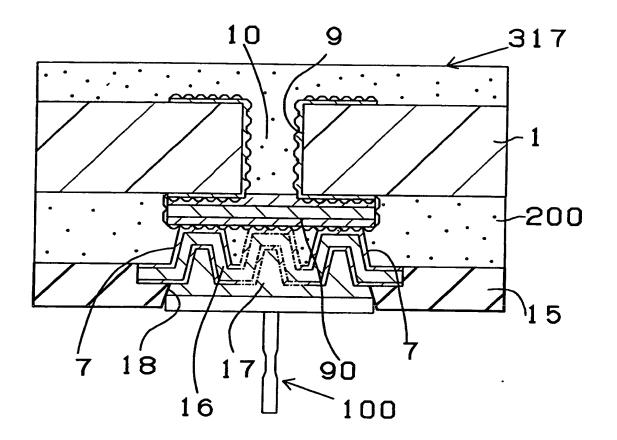


【図14】



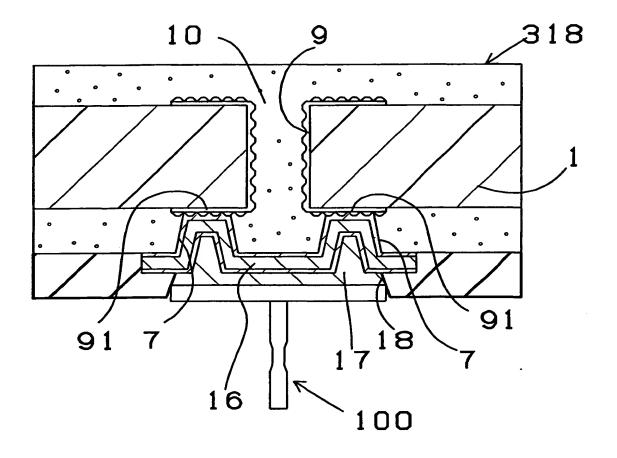


【図15】



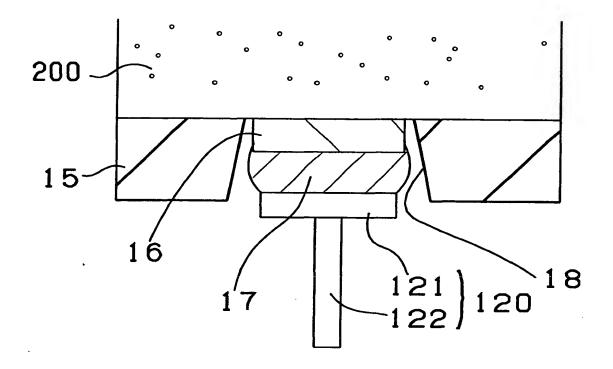


【図16】





【図17】





【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 ヒートサイクル条件下や、実装の際に、応力が集中し難い導電性接続ピン、および、係る応力が加わっても導電性接続ピンが剥離し難い樹脂パッケージ基板を提供する。

【解決手段】 導電性接続ピン100が、柱状の接続部102と板状の固定部101よりなり、接続部102に他の接続部の直径よりも細いくびれ部103が設けられている。このため、ヒートサイクル時やパッケージ基板の装着時にピン100に加わる応力をくびれ部103が曲がることで吸収し、ピン100が基板から剥離するのを防止できる。

【選択図】 図8

出願人履歴情報

識別番号

[000000158]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

氏 名 イビデン株式会社